Nb₃Sn 線材の高強度化のための銅合金の研究 Study for Cu alloy for high strength Nb₃Sn wires

<u>谷口</u>博康(大阪合金);菊池 章弘(NIMS);菱沼 良光(NIFS);水田 泰次,水田 泰成,野邑 武志(大阪合金) <u>TANIGUCHI Hiroyasu</u>(OAW);KIKUCHI Akihiro (NIMS);HISHINUMA Yoshimitsu (NIFS); MIZUTA Taiji, MIZUTA Yasunari, NOMURA Takeshi (OAW)

E-mail: taniguchi@osakagokin.co.jp

1. はじめに

超伝導磁石の高磁場化にともない、Nb₃Sn 素線の高強度 化は重要な課題として認識されている。ブロンズ法ならびに内 部スズ拡散法線材のいずれにおいても、Nb₃Sn フィラメントの 周囲にある銅母材は、600~800℃の Nb₃Sn 生成熱処理で完 全焼鈍された純銅と類似して軟らかくなり、さらにはわずかに Sn が残留しているため安定化材としての貢献度も低い。従っ て、現状は熱処理後に無駄なパーツとなっている銅母材を高 強度化できれば、幾分の素線補強に寄与すると考えるのは自 然な成り行きであろう。

ところで、高強度の銅合金は広く世の中に流通している。 半導体のリードフレーム、鉄道架線のトロリー線、導電性ばね 材・接点材等々には、Zr、Sn、Ni、Fe、Cr、Agなどを微量含有 する銅合金が使われている。一般に、金属の強化機構には 以下の4つが挙げられる。

- 1. 固溶強化
- 2. 析出強化
- 3. 加工硬化
- 4. 組織微細化による強化

実用高強度銅合金は、上記の機構を背景として必要とする強度を担保している。本研究の対象である Nb₃Sn 線材の高強度 化においては、以下に列記する様々な線材製造条件をクリア した後に高強度化が達成されなくてはならない。

- 1. Nb との複合加工性を阻害しないこと。
- 2. Cu 中の Sn の固溶や拡散を阻害しないこと。
- 3. 600℃程度の中間焼鈍が適用可能なこと。
- 4. Nb₃Sn 生成熱処理後に強度が担保できること。
- 5. Nb₃Sn にとって有害元素とならないこと。

特に、4及び5項の条件は Nb₃Sn 線材において重要である。

本研究では、まずは4項の条件を見極めるべく、様々な元素を希薄濃度で添加した二元系銅合金を作製し、既存知見 と照らしながら、組織と機械的特性について研究を行った。

2. 実験方法

今回の実験では、添加元素として 10 種類(Sn、Zn、Ti、Be、 Ag、Al、Ni、Ga、Cr、Zr)を選択した。添加元素濃度はそれぞ れ 0.2~10mass%の範囲で段階的に組成を振り、多くは銅に 固溶する濃度であるが、一部、固溶限を超えた組成も存在す る。作製した試料のリストを Table 1 にまとめた。

試料インゴットは、大阪合金工業所において黒鉛坩堝を直 接水冷しながら一方向凝固させる「水田式溶製法」により溶製 したが、一部、物質・材料研究機構の真空溶解及び真空鋳造 法により作製した。溶製塊は量産サイズ(~ φ 220 mm)よりも 小さい φ 80 mm の実験サイズで溶製し、溶製後は組織の均質 化をはかるために 600℃で 200 時間の均質化熱処理を大気 中で実施した。この長時間の均質化熱処理は、謂わば、 Nb₃Sn 生成のための長時間拡散熱処理を模擬しているとも考 えられる。その後塊の底部側より80 mmの位置を基準に、厚さ 10 mm のスライス片を2 枚採取し 10 mm 角の 75 mm 長さの素 材を切り出した。同素材からJIS14号比例(平行部直径;7mm、 平行部長さ;35 mm)を切削加工し引張試験片を用意した。 また試験後の掴み部を切断した後、断面を機械研磨し硬度 測定用の試料とした。

Cu-X alloy	Additive element concentration (mass%)
Cu – Ti	0.5 / 1.0 / 2.0
Cu – Be	0.2 / 0.5 / 1.0
Cu – Ag	1.0 / 5.0 / 10.0
Cu – Cr	0.2 / 1.0 / 2.0
Cu -Ga	0.5 / 1.0 / 3.0
Cu – Zr	0.5 / 1.0 / 3.0
Cu – Al	0.5 / 1.0 / 3.0
Cu – Ni	0.5 / 1.0 / 3.0
Cu – Sn	0.5 / 1.0 / 3.0
Cu – Zn	1.0 / 5.0 / 10.0

Table 1 List of Cu-X alloys for present study.

機械的特性の評価として、ビッカース硬度は㈱明石製作所 製のAVK-COを使用し、測定荷重は10kgfとし、圧子据え込 み後の保持時間を7secで統一、7箇所の測定を行い最大値 と最小値を除外した5箇所の平均値で測定値を示した。引張 試験は島津製作所製のオートグラフ(AG-100kND)を使用し た。試験片の平行部に微少歪ゲージを貼り、耐力・破断強 度・伸びの計測を測定し、同組成2試料の平均値をとった。

3. 実験結果

いずれの二元系銅合金も試料作製において特段の問題 はなかった。Fig. 1 は、600℃で 200 時間の均質化熱処理後 の試料の 0.2%耐力(室温)を比較したものである。本研究では、 Cu-Zn、Cu-Ni、Cu-Ga系合金は無酸素銅と大差がないという 結果が得られた。しかし、Cu-Sn、Cu-Cr、Cu-Zr、Cu-Ag 系 合金は無酸素銅の約二倍、Cu-Be 及び Cu-Ti ではさらに顕 著な上昇が認められた。特にベリリウムは他の元素の群を抜 いて高強度化の効果が明確である。今回の含有量は、所謂 市販のベリリウム銅より濃度が低い。さらに、一般に毒性があ るのはベリリウム化合物とされ、固体や最終製品のベリリウム 銅が健康へ特に影響を与えることはないと言われている。



Fig. 1. 0.2% proof stress of Cu-X alloys.

Zn 固溶ブロンズ母材を用いた Nb₃Sn 線材の機械的特性

Mechanical properties of Nb₃Sn multifilamentary wires using various

Zn solid solution bronze matrices

菱沼 良光 (核融合研);小黒 英俊 (東北大金研、現東海大);谷口 博康 ((株)大阪合金工業所);

菊池 章弘(物質·材料研究機構)

HISHINUMA Yoshimitsu (NIFS); OGURO Hidetoshi (IMR Tohoku Uni., Tokai Uni.);

TANIGUCHI Hiroyasu (OAW); KIKUCHI Akihiro (NIMS)

E-mail:hishinuma.yoshimitsu@nifs.ac.jp

1. はじめに

Nb₃Sn 線材における臨界電流密度(J_e)特性のひずみ感受 性が明らかになり、Nb₃Sn 線材の耐ひずみ特性の改善ある いは高強度化は大きな課題である。これまで、Ta や CuNb 等 の補強材を用いた Nb₃Sn 線材の高強度化が図られている。 一方、我々は Zn を固溶した高 Sn 濃度 Cu-Sn-Zn 合金母材 を用いた Nb₃Sn 極細多芯線材の試作に成功し、Zn による Nb₃Sn 相の生成促進効果と均質な Zn の母材中での残存を 報告している[1]。そして、残存した Zn が Nb₃Sn 相生成後の 母材の固溶強化に寄与する可能性があり、Nb₃Sn 相生成後の 高強度化への新しい試みとなると考えられる。そこで、Zn を固 溶した Cu-Sn-Zn 合金母材を用いた Nb₃Sn 極細多芯線材の 機械特性を明らかにする目的で、Nb₃Sn 相生成熱処理前後 の合金母材の硬度変化と臨界電流特性における引張ひずみ 効果を評価した。

2. 実験方法

Table.1 に示すような種々の Sn とZn 量の Cu-Sn-Zn 母材 を用いたブロンズ法 Nb₃Sn 極細多芯線材(線径:0.9mm) と通 常のブロンズ法 Nb₃Sn 線材(線径:0.82mm) を用意し、550 $^{\circ}$ -100h+650 $^{\circ}$ -100h の二段熱処理を行った。その際、Ar 雰囲 気とし、熱処理過程での Zn の蒸発を抑制する目的である。熱 処理前後の微細組織や母材の組成変化は、FE-SEM とEDX にて評価した。

熱処理前後の硬さ試験は、鏡面研磨を行った線材断面に て行い、四角錐型のダイアモンド圧子によるビッカース硬度 計(MITSUTOYO HM-200)を用いた。試験条件は 9.8 mN (1gf)の荷重を 30 秒間印加とし、ブロンズ母材の任意の 3 箇 所を測定し、それらの平均値を硬度とした。

一方、臨界電流特性における引張ひずみ効果は、超伝導線材の機械特性の評価に実績のある東北大金研の協力のもと、強磁場下引張ひずみ印加装置を用いて、4.2K@15Tの条件で評価した。応力は、試料プローブに接続したロードセルの出力と線材断面積にて算出した。また、ひずみ量は、線材を上下に挟むように接着したひずみゲージの出力の平均と

Table. 1 Nominal composition of the Cu-Sn-Zn bronze matrices for the bronze processed Nb_3Sn multifilamentary wires

ltem (code)	Matrix (mass%)
Sample-A	Cu-10Sn-10Zn-0.3Ti
Sample-B	Cu-12Sn-6Zn
Sample-C	Cu-12Sn-6Zn-0.3Ti
Sample-D	Cu-13.5Sn-4Zn-0.3Ti
Ref.	Cu-16Sn-0.2Ti



Fig. 1 Changes of Vickers hardness in the various Cu-Sn-Zn matrices before and after the heat treatment

した。なお、 l_e 基準は 1 μ V/cm の電圧が発生した時の電流値 とした。

3. 実験結果

Fig.1 に種々のCu-Sn-Zn合金母材における熱処理前後の ビッカース硬度変化を示す。熱処理前では、Sn 濃度が最も高 くZnを含まない通常のブロンズ母材が最も高い硬度を示し、 そしてZn 濃度よりもSn 濃度に呼応して硬度は高くなる傾向 が見られた。ブロンズ合金の硬度は、ZnよりもSnの方が固 溶強化因子として有効であることが示唆された。しかしながら、 熱処理後の硬度は、全てのZn固溶母材が通常のブロンズよ りも高くなる傾向が見られた。これは、固溶強化に作用する Sn が熱処理によって母材からほぼ全量 Nb に拡散したため であり、その結果Znが残留する母材の硬度が相対的に高く なったと考えられる。当日は、硬度変化に加えてJc特性にお ける引張ひずみ印加測定結果についても報告する。

参考文献

 Y. Hishinuma et al.: J. Cryo. Super. Soc. Jpn., Vol. 50, (2014), p.194-201.

謝辞

本研究は NIFS 核融合工学プロジェクト(UFFF036)、NIFS 一般共同研究(NIFS14K ECF013)、及び科研費(基盤 (B)16 H04621)の支援を受けた。そして、東北大学金研共同 利用研究(15 H0024)に採択されて実施した。

Cu 合金母材を用いた新しい内部スズ法 Nb₃Sn 線材の研究 Studies on new internal-tin method Nb₃Sn wires using Cu-alloy matrix

<u>伴野信哉</u>(物材機構); 宮本泰男(東海大学); 太刀川恭治(物材機構) <u>BANNO Nobuya</u>(NIMS); MIYAMOTO Yasuo (Tokai University); TACHIKAWA Kyoji (NIMS) E-mail: banno.nobuya@nims.go.jp

1. はじめに

我々は、Nb₃Sn 線材の機械的強度の向上を図ることを第一 の目的に、Cu 母材の代わりに Cu 合金母材を用いた内部スズ 法 Nb₃Sn 線材の開発を進めており、まず、Brass 母材線材につ いて研究してきた[1, 2]。その結果、Zn は Nb₃Sn 生成後も母材 中に均一に残留すること、さらに Nb₃Sn 層の生成を促進する効 果があることを示した。今回、J。向上の可能性を探るために、 Brass 母材線において Nb 芯をさらに細径化した線材(芯数 817) を作製した。加えて新たに Cu-5wt%Ge 母材を用いた内部 Sn 法 Nb₃Sn 多芯線材を試作した。Ge は Nb₃Sn 芯に被覆層を作り、 機械的性質を改善する効果が期待されるとともに、Nb₃Sn 粒界 のピン止め効果向上の可能性も考えられる。本稿では、EPMA を用いてこれら線材内の Sn と Ge の拡散挙動並びに Nb₃Sn 層 生成への影響ついて研究した結果を報告する。

2. 試料作製

Cu 合金母材を使用する際の加工硬化の影響を軽減するために、線材構造は Nb フィラメントと Sn フィラメントを分離して配置する分離型とした。Nb シングルのみを Cu 合金マトリクスとすることで、Sn シングルの中間焼鈍を不要とし、Nb シングルは最終マルチスタック前まで中間焼鈍が可能となる。Fig. 1 (a) は分離型構造の Nb 芯を 2 回スタック・伸線して極細多芯化した Cu-15 wt % Zn 母材線材の断面写真である(試料名: M-15Zn-0.6 \oslash ~1.0 \oslash)。Fig. 1 (b) は、従来通り Nb 芯材を 37本組み込んだ Cu-5wt%Ge 母材線材の断面写真である(試料名: 5Ge-0.6 \oslash ~1.0 \oslash)。断面構成の違いにより、分離型極細多芯 Cu-15Zn 線材の Nb 芯占積率は 23.5%、一方、Cu-5Ge 線材のそれは 30%となった。

3. 結果と考察

Fig. 2 に、試料 5Ge-1.0Øにおける 650℃熱処理後の Sn お よびGeのEPMAマップを示す。GeはTiと結合しやすく、Ge-Ti 化合物を構成して拡散する。Brass 母材と比べると、Ge 添加母 材では Sn の拡散が遅いが、Ti の Sn 拡散促進効果を Ge が打 ち消したことも考えられる。Brass 母材では Zn-Ti 系化合物は生 成されない。Ge-Ti 化合物の母材内の動きは速い。Brass 母材 線では、650℃でも Nb₃Sn 層が形成されるが、Cu-5Ge 母材線 では薄く Ge-Ti リングが出来る。Fig. 3 に 5Ge-0.6Øにおける 750℃×100h 熱処理後の EPMA マップを示した。Ge-Ti 層が Nb 芯周りに強固に形成されることが確認できる。この化合物リ ングがNb₃Sn芯の高強度化につながると期待される一方、Snの Nb 芯への拡散をブロックする可能性もある。Table 1 に Cu-5Ge と同構造の Brass 母材線(15Zn-0.6Ø)の EPMA 分析の結果 も示した。比較すると、Cu-5Ge 母材線はマトリクスの残留 Sn 濃 度が明瞭に高い。残留 Ge はほぼゼロになる。Brass 母材線に 比べると、Cu-5Ge 母材線材では 750℃の熱処理にもかかわら ず Nb₃Sn 層はそれほど厚く生成されていない。4.2K、12 T にお けるシース部を除いた線材の J. は約400 A/mm²で、Brass 母材 線よりも5割程度低い値となった。今回、Cu-Ge合金中のGe 添加量を 5wt%としたが、Nb₃Sn 層生成の面からは多過ぎたと考

えられる。母材高強度化と超伝導特性の両立には、添加元素 を種々の見地から検討する必要がある。Brass 母材への微量 Ge 添加で好結果が得られる可能性もあろう。

一方、新たに極細多芯化した Cu-15wt%Zn 母材線材では、 極めて良好な加工性が得られた。Nb 芯の極細化は高 J。化に 有望であり、今後まず EPMA により極細多芯線内の Sn、Zn の 拡散挙動について研究を進める予定である。

[1] Tachikawa et al., Physics Procedia, v. 65, 2015[2] N. Banno et al., TASC, DOI: 10.1109/TASC.2016.2531123



Fig. 1. Cross-section of present wires: (a) brass matrix 817 core wire, (b) Cu-5wt%Ge alloy matrix 37 core wire.







Fig. 3. Local EPMA mappings on the cross-section of 5Ge-0.6Ø wires heat treated at 750°C: (a) Sn, (b) Ge.

Table	1.	EPMA	results	on	Cu-	-5Ge	and	Cu-	-15Zn	matrix	wire.

XX 7	Т	Time	Matrix (wt%)				
wire	(°C)	(hr)	Cu	Sn	Ge	Zn	
5Ge-0.6Ø	650	100	87.28	10.65	2.08	-	
	750	100	94.35	5.65	≈ 0	-	
15Zn-0.6Ø	650	100	81.09	7.96	-	10.95	
	700	200	85.37	3.02	_	11.62	

銀バリア型 RHQT Nb₃AI 線材の開発 Development of Ag-barrier type RHQT Nb₃AI wires

<u>伴野信哉</u>, 竹内孝夫, 北口仁, 飯嶋安男 (物材機構); 宮下克己 (SH カッパープロダクツ)

BANNO Nobuya, TAKEUCHI Takao, KITGUCHI Hitoshi, IIJIMA Yasuo (NIMS); MIYASHITA Katsumi (SH Copper Products) E-mail: banno.nobuya@nims.go.jp

1. はじめに

我々は、急熱急冷・変態(RHQT)法 Nb₃Al 線材の難課題で あった前駆体線材の長尺性、フィラメント結合による磁気的不 安定性、銅安定化材の付与を同時に解決する実用線材の実 現を目指し、銀バリア型の Nb₃Al 線材の開発を進めてきた。そ の目途が立ってきたので報告する。マトリクスは、Ta を必要とし ない Nb/Ag 複合構造で構成され、構成材料はいずれも良加 工性であり、前駆体線材の伸線は極めて良好である。急熱急 冷後も良好な加工性が維持され、安定化銅付与として急冷後 機械的複合加工(リスタック法)が可能である。本稿では、4.2 K ならびに 1.8 K におけるヒステリシス特性、急熱急冷後の断面 組織、J₆特性等について研究した結果を報告する。

2. 線材作製

前駆体線材はいわゆるジェリーロール(JR)法で作製される。 ただし、JR シングルビレットの外皮として Cu ではなく Ag パイプ を用いる点が従来と異なる。まず Nb と Al のシートを共巻きし、 さらに拡散バリアとして Nb シートを余計に巻く。それを Ag パイ プに挿入して押出・伸線する。一般的にAgとNbは密着性が非 常に悪いため、本線材では、AgとNbの間にAlを1層挟む工 夫をした。伸線後通常は JR 外皮部分をエッチング除去するが、 本線材ではそのまま使用するためエッチング作業が省略される。 伸線した複合材を短く切り分け、マルチビレットを構成し、Ta 層 とともに Cu-Ni 管に配置して押出・伸線したのち、Cu-Ni 外皮を エッチング除去して前駆体線材とする。Nb ではなく Ta 外皮と するのは、急熱急冷時に表面に形成され、別工程で付与する 安定化材との密着性不良の要因となる化合物相を抑制するた めである。前駆体線材を急熱急冷したのち、銅管(外径/内径 =3/2 mm)に挿入し、ダイス伸線を行って機械的に安定化銅 を付与し、Ø0.85、銅比 1.91((銅+銀)比:2.49)の線材とした。 線材断面写真をFig.1(a)に、フィラメントバリア構造の模式図を (b)に示す。

組織観察はFESEMで行い、組成分析はEDXにより行った。 SQUID装置による磁化測定は、端部を研磨した約3mm長の試料に対し4.2 Kならびに1.8 Kで行った。J。は、Agバリア部分も安定化に寄与するものとして、non-(Cu+Ag)当たりの値として求めた。

3. 結果と考察

急熱急冷時 Ag は溶融するためフィラメント位置が若干ずれ るが、フィラメント同士が接触することはなかった。Ag は Nb と全 く反応せずに残存する。Fig. 2 に熱処理後のフィラメント領域に おける Al および Ag の EDX マップを示す。Ag はフィラメント周 囲に残存しており、フィラメント内への拡散は確認されない。Fig. 3 に、4.2 Kならびに 1.8 K におけるヒステリシス曲線を示す。Ag バリア層によりフィラメント間の磁気的結合が抑制されており、 Nb マトリクスで問題となっていた低磁界でのフラックスジャンプ は 4.2 K だけでなく 1.8 K でも観測されなかった。±3 T のヒス テリシス損失は 512 mJ/cm³であり、ITER 用線材の要求仕様を 十分満足している。Fig. 4 に non-(Cu+Ag) J_c-B 特性を示した。 従来線材に比べ、2割程度低い特性となった。Agによる汚染が ないとすると、急熱急冷速度等が影響している可能性もある。 今後熱処理条件の最適化を進めていく予定である。



Fig. 1. Cross-section of Cu-stabilized precursor wire (left) and schematic illustration of Nb/Ag/Nb layed-barrier (right).



Fig. 2. EDX mapping (Al, Ag) on the filamentary region of the Ag-barrier Nb₃Al wire after heat-treatment.



Fig. 3. Hysteresis characteristics of the Ag–barrier $\rm Nb_3Al$ wire at 4.2 K and 1.8 K.



Fig. 4. $J_{\rm c}\text{-}B$ characteristics of Ag–barrier $\rm Nb_3Al$ wire and conventional Nb matrix wire.

拡散法 Nb₃AI 線材の将来展望 Perspective view for diffusion-processed Nb₃AI wires

<u>伴野信哉</u>,北口仁 (物材機構); 宮下克己 (SH カッパープロダクツ) <u>BANNO Nobuya</u>, KITGUCHI Hitoshi (NIMS); MIYASHITA Katsumi (SH Copper Products) E-mail: banno.nobuya@nims.go.jp

1. はじめに

低温拡散法 Nb₃Al 線材は 10 年以上前には核融合炉用を中 心に精力的に研究されていたが、1990 年代半ばに急熱急冷・ 変態法が開発されて以来、拡散法の研究は徐々に減り、現在 において既に 10 年以上の開発の空白期間がある。しかしなが ら、低温では熱平衡的に化学量論組成が得にくい問題がある 一方で、長尺性・大量生産性の点で優れた実績もありポテンシ ャルは大きい。本研究は、これまでの開発状況を概観し、最近 行った基礎研究の結果とともに、拡散法 Nb₃Al 線材の改善に 向けて何ができるのか、どのような方向性が考えられるかを考 察する。

2. 拡散法線材の開発状況

Nb₃Sn と異なり、Nb₃Al の生成では、Nb と Cu、Al が安定な 3 元化合物を形成するため、いわゆるブロンズ法が適用できず、 基本的には 2 元素のみの拡散反応が必要となる。加えて、化 学量論組成(理想的に Nb:Al が 3:1 の相)が高温でのみ安定で あるため、低温で化学量論組成を改善させるためには、Nb/ Al 拡散長を 100 nm 以下にまで微細化する必要がある。こうし た背景の中で、Nb₃Al 線材開発では、PIT 法[1]、RIT 法[2]、 CCE 法[3]、JR 法による開発が進められた。この内 JR 拡散法は 実用性が高いと考えられ、原研(現 量子機構)主導の下、 2000 年初期にかけて精力的に開発が進められ[4, 5]、数 km の 線材開発、加えて CIC 導体、CS インサートコイルなどが開発さ れ実証性の高さが示された[6]。

JR 拡散法では、ジェリーロールを構成する Nb 箔及び Al 箔 の薄膜化を達成したことにより、典型的な J_c 特性として、12 T の 磁場下において 700 A/mm²を超える性能のものが得られるよう になった。前駆体線材における Al 層厚は典型的には 8、90 nm 程度であり、性能の良いもので 800 A/mm² 程度の値が達成さ れている。一方で竹内らの RIT 法線材の研究によれば[7]、拡 散法 Nb₃Al 線材のピンニング特性では、Al 芯径で 40 nm 辺り にピークが現れており、 J_c 改善の可能性が残されている。実は この時、 T_c 、 B_{c2} のピークは 70 nm 程度のところに位置しており、 40 nm では若干低下しているが、Al 芯径が変われば最適熱処 理条件も変わるかもしれない。また、安定な Nb₃Al 相が化学量 論組成よりも Nb リッチ側に存在することから、JR 拡散法では Nb を3:1 よりも若干高めに仕込んでいた。Al 芯径を縮径化すると、 仕込み組成にももう少し自由度が生まれるかもしれない。

RIT 法では、NbとAlの高度のバランスを取る必要性から、純 Al ではなく、Mgなどを微量添加した Al 合金が用いられていた が、超伝導特性に与える元素添加効果は十分議論されておら ず、研究の余地は残されている。

3. 予備実験

以上の背景を踏まえ、まず現状でどのくらいの技術が維持されているか見るために典型的な仕様で試作を行った。Fig. 1 (a) に試作線材断面を示す。当初 Al 層厚で 90 nm を目指していたが、結果的には 130 nm 辺りで断線が生じた。この線材に対し、引き抜き力の小さい CRD (カセットローラーダイス) 伸線を 行い、82 nm までさらに層厚の縮小を試みたが、断線はないも のの、フィラメントが剪断変形している箇所が見受けられた。Fig. 2 に、800°C×10 h の熱処理を施した試作試料のフィラメント当 たりの J_c -B 特性を示す (Cu マトリクスでは non-Cu J_c に相当す る)。Al 層厚 130 nm での 12 T における J_c は 400 A/mm²弱で あり、線径を細くしても顕著な J_c の向上は見られなかった。剪断 変形箇所からフィラメントが Cu に汚染されたためと考えられる。

別の予備実験として、急熱急冷用として作製された Nb マトリ クス線材を同じく 800°C で低温拡散熱処理し、線径(Al 層厚) に対する特性の変化を調べた。この試料の J_c 特性についても Fig. 2 に含めた。Al 層厚が 170 nm では先の Cu マトリクス線材 と同等の J_c 特性であったが、CRD により線径を縮径し Al 層厚 60 nm 程度にすると、J_c 特性は 12T で 800 A/mm²以上に大幅 に改善する結果が得られた。これらの結果から、Al 層厚を均一 に縮小することが J_c 向上のキーになり得ることが示唆される。今 後併せて Mg 添加等の効果も研究する予定である。

- [1] K. Watanabe et al., IEEE TMAG 25 (1989), 1984
- [2] K. Inoue et al., Appl. Phys. Lett. 50 (1988), 1724
- [3] S. Saito et al., J. Japan Inst. Metals 53 (1989), 458
- [4] N. Ayai et al., IEEE TASC 5 (1995), 893
- [5] F. Hosono et al., IEEE TASC 11 (2001), 1855
- [6] N. Koizumi et al., TEION KOGAKU 38 (2003), 391
- [7] T. Takeuchi et al., Appl. Phys. Lett. **53** (1988), 2444 など



Fig. 1. Cross-section of precursor wires: (a) Cu matrix (\emptyset 1.16 mm, Al thickness: 130 nm), (b) Nb matrix wire which was designed for RHQT (\emptyset 1.35 mm, Al thickness: 170 nm).



Fig. 2. Filament J_c of Cu matrix wires and Nb matrix wires after low temperature diffusion process at 800°C for 10 h.

— 35 —

フィラメント間バリアを合金化した RHQT 法 Nb₃AI 線材の作製 Fabrication of RHQT-processed Nb₃AI wires with filament barrier alloying

<u>菊池 章弘</u>, 飯嶋 安男, 平田 和人 (NIMS); 土屋 清澄 (KEK) <u>KIKUCHI Akihiro</u>, ILJIMA Yasuo, HIRATA Kazuto (NIMS); TSUCHIYA Kiyosumi (KEK) E-mail: KIKUCHI.Akihiro@nims.go.jp

1. はじめに

RHQT (Rapid-Heating/Quenching and Transformation)法 Nb₃Al 線材では、フィラメント間バリア並びに母材として、高融 点金属の純ニオブあるいは純タンタルが使用される[1]。フィラ メント間バリア材には、線材製造・応用順に以下の点が求めら れる。

- 1. Nb/Al ジェリーロールフィラメント部とバランス良く冷間塑 性加工ができ、フィラメントが異常変形しないこと。
- 約2,000℃のRHQ処理中でも機械的強度を保ち、構造体としての機能を果たすこと。
- 3. 約 2,000℃の RHQ 処理を行った際に、Nb/Al ジェリー ロールフィラメント部と反応しないこと。
- 4. RHQ 処理後に生成した Nb-Al 過飽和過飽和固溶体 フィラメントとバランス良く冷間塑性加工ができ、フィラ メントが異常変形しないこと。
- 5. 線材使用温度においてフィラメント結合を生じさせず、 磁気的安定性が確保できること。
- 6. 願わくは、高強度の補強材として素線の高強度化に 貢献する機能を有すること。
- 7. 願わくは、何らかの方法によりフィラメントを分割露出 させて超伝導接続が可能となる材質であること。
- 8. 願わくは、加速器や核融合マグネットにおける中性 子照射による影響が少ない(ない)材質であること。

上記の条件をすべて満たすフィラメント間バリア材の実現は、 極めてハードルが高い。しかし最近の我々が検討しているア プローチであれば、かなり多くの条件をクリアできる可能性が ある。我々の新しいアプローチは、ニオブ箔かタンタル箔をバ リア母材のベースとし、そこに強磁性金属箔を巻き込んで RHQ 処理後にバリア部を合金化させるというユニークなもの である[2,3]。現在のところ、これまでの実験結果から確認され る主たる効果・特徴は以下の3点である。

- アブリコソフーゴルコフ理論に基づいた不純物効果 によりニオブあるいはタンタルの超伝導特性を劣化 (消失)させ、フィラメント結合を抑制する。
- 2. 合金化により、バリア部の硬度を上昇させて Nb-Al 過 飽和過飽和固溶体フィラメントとの硬度バランスを保ち、 フィラメントの異常変形を抑制する。
- 3. 過飽和過飽和固溶体から Nb₃Al 相への変態熱処理 後も、合金バリア材は高強度のハニカム構造を保って 線材強度を向上させる。

今回、新たなバリア材の構成(①純ニオブ/純ニッケル、② 純ニオブ/汎用アルミ合金、③純タンタル/純ニッケル)で線材 試作を行った。

2. 試作線材の結果

Fig. 1は、純ニオブ/純ニッケルの組合せのバリア構造とした 前駆体線材の加工直後の断面写真である。外径は約1.0 mm であり、Nb/Alジェリーロールフィラメントも、ビレット組込み時 のきれいな六角形状を保持しており異常変形していない。



Fig. 1 Jelly-Rolled multi-filament precursor with pure niobium and pure nickel lamination barrier.

Fig. 2は、RHQ処理を施した上記線材に対して、フィラメント バリア部を拡大して測定したEPMA元素マッピングである。バ リア部のみにニッケルが観察される。



Fig. 2 EPMA mapping of filament barrier region after RHQ treatment.

参考文献

- A. Kikuchi, et al.: "Cu Stabilized Nb₃Al Strands for the High Field Accelerator Magnet", IEEE Trans. Appl. Supercond. 18 (2008) 1026-1030.
- 菊池章弘等:「新しい Nb/Al ジェリーロール前駆体線材」,第 91回 2015 年春季低温工学・超電導学会概要集, p. 94.
- 3. 菊池章弘等:「新しい合金バリア Nb₃Al 線材の組織と臨界 電流密度」,第92回2015年秋季低温工学・超電導学会概 要集, p. 230.

— 36 —

Gaドープ Y123 溶融凝固バルクの微細組織制御

Control on microstructure of Ga-doped Y123 melt-solidified bulks

<u>松本</u>和也, 瀬戸山 結衣, 岸尾 光二 (東大院工); 佐藤 巧望, 元木 貴則, 下山 淳一 (青学大) MATSUMOTO Kazuya, SETOYAMA Yui, KISHIO Kohji (Univ. of Tokyo); SATO Takumi, MOTOKI Takanori, SHIMOYAMA Jun-ichi (Aoyama gakuin Univ.)

E-mail: 9918217367@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

1. はじめに

REBa₂Cu₃O₄(RE123)溶融凝固バルクの強力な超伝導磁石 としての応用では液体窒素温度より低温での運転が想定され ているが、これまでの研究では主に 77 K において J_-H 特性 の最適化が行われてきた。77 K で最も良い特性を示す作製 条件が、低温でも最も良い特性を示す条件と一致するとは限 らないため^[1]、RE123 バルクの用途拡大や機能向上には、 20~60 K の温度域での Jc-H の最適化が必要である。これまで に我々は、Ba サイトへの RE の部分置換がある程度進むと、 低温での Jc の上昇が抑制されることを指摘してきた。また、低 温固相反応により合成した Y123 と Y211 を用いて作製した 10 mm Ø Ga 添加、Pt 無添加バルクが、40 K では、10 T まで 5×10⁵ A cm⁻²以上の J_cを示すことを見出した^[2]。さらに最近、 17 mm ゆのバルク中にも、40 K, 12 T まで 5×10⁵ A cm⁻² 以上の Jc を維持する領域があることがわかったが、このバルクでは Jc の位置依存性が大きかった。Pt 無添加バルクでは磁場中のJ。 は向上する一方でY211が粗大化する傾向がみられており、こ れを微細化することで J. の向上ができると考えられる。また、 RE2O3を原料として用いる Infiltration growth 法によって、バ ルク中の RE211 の微細化、均一化が図れることが報告されて いる^[3]。以上の背景のもと、本研究では、Ga微量ドープ、Pt無 添加の Y123 溶融凝固バルクを作製し、バルク内の様々な部 分の微細組織、超伝導特性を系統的に調べた。

2. 実験方法

Infiltration growth 法により Ag 添加、Gaドープ Y123 バル クを作製した。原料は 2 つのペレットからなり、上側のペレット は Y₂O₃, BaCuO₂をモル比1:1.2 で混合し、Ag₂O をバルク全 体の10 wt%加えて作製した。下側のペレットはY₂O₃, BaCuO₂, CuOをモル比1:10:6 で混合し作製した。BaCuO₂はBaCuO, CuOを910°C, 48 h焼成して作製し、CuO 鎖に対して0.5-1.4% の Ga がドープされるよう Ga₂O₃ を加えている。

Nd123 単結晶を種結晶としてペレット上面に設置し、底面 加熱方式の電気炉にて空気中で溶融凝固を行った。作製し た溶融凝固バルクから小片を切り出し、所定の温度にて100h 以上の酸素アニールを行った後、SQUID 磁束計による磁化 測定により超伝導特性を評価し、走査型電子顕微鏡により微 細組織を観察した。

3. 結果と考察

種結晶から動径方向の距離を L_a 、下方への距離を L_c とする。 Infiltration growth 法(左)、および通常の TSMG (Top seeded melt-growth) 法(右)により作製した Pt 無添加バルクの研磨面 の二次電子像を Fig. 1 に示す。TSMG 法で作製したバルクと 比較し Infiltration growth により作製したバルクでは種結晶直 下での Y211 が多く存在することがわかる。40 K における J_c の 磁場依存性を Fig. 2 に示す。今回作製した Infiltration growth 法によるバルクでは J_c の位置依存性が小さい傾向にあること がわかった。 講演では、溶融凝固時の温度パターンと微細組織、J_cの関係についても議論する予定である。

参考文献

- [1] Y. Ishii et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 19 (2009) 3487-3490.
- [2] S. Yamaki et al., Abstracts of CSSJ Conference 89 (2014) p.173.
- [3] M.Wang et al., Physica C 492 (2013) 129-132.



Fig. 1 Secondary electron images of the Y123 bulks synthesized by infiltration growth method (left) and TSMG method (right).



Fig. 2 Magnetic field dependence of J_c at 40 K for small pieces cut from the Ga-doped Y123 melt-solidified bulk fabricated by infiltration growth method.

Ag 添加 RE 混合 REBCO 溶融凝固バルクの臨界電流特性 Critical current properties of Ag-added and RE-mixed REBCO melt-solidified bulks

瀬戸山 結衣,松本 和也,岸尾 光二(東大院工);佐藤 巧望,下山 淳一(青学大院理工)

SETOYAMA Yui, MATSUMOTO Kazuya, KISHIO Kohji (the Univ. of Tokyo);

SATO Takumi, SHIMOYAMA Jun-ichi (Aoyama Gakuin Univ.)

E-mail: 6071721904@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

1. 緒言

REBa₂Cu₃O_y (REBCO, RE123)溶融凝固バルク磁石の捕 提磁場向上にはバルク内部を流れる臨界電流密度 J_cの向上 が有効である。我々はこれまで、複数の RE 元素を用いて作 製した RE 混合 REBCO バルクが優れた J_c-H 特性を示すこと を報告してきた[1]。REBCO バルクの代表的なピンニングセン ターの一つである Ba サイトの RE の部分固溶(RE/Ba 固溶)領 域は RE のイオン半径が大きいほど生じやすいが、RE 混合に よりその固溶量を精密に制御でき、母相の超伝導凝縮エネル ギーの低下を抑制できたためであると考えられる。

一方、REBCOバルクは着磁の際に、高いJ。による大きな 電磁力がかかり、バルクに残存したボイドなどを起点に破壊が 起こりやすいことから機械的強度の改善も強力バルク磁石開 発では重要となる。本研究では、代表的な機械的強度改善 手法である銀の添加によりボイドを埋めたRE混合バルクの育 成条件を確立した。また、それぞれの銀添加試料に対して酸 素アニールの温度を最適化し、その超伝導特性を評価した。

2. 実験方法

RE₂O₃ (RE = Gd, Dy, Y, Er), BaCO₃, CuO の原料粉末を 混合し、固相反応法によりRE'123 粉末とRE''211 粉末を合成 した。これらを RE'123 : RE''211 = 7 : 3 (モル比) + 0.1 wt% Pt + 10 wt% Ag₂O となるように混合し 20 mm ϕ に成型した 前駆体から種結晶(Nd123 単結晶)を用いて大気中で育成し た溶融凝固バルクを(RE',RE'')BCO と表記する。動径方向の *a*-growth 領域、種結晶直下の *c*-growth 領域から~2 mm × 2 mm × 1 mm^{//c} の小片試料を切り出し、酸素気流中で所定温 度にて 100 h 以上アニールを行った。*J*_cは SQUID による磁化 測定から拡張 Bean モデルを用いて算出した。以下では、 *c*-growth 領域の試料を切り出した位置を種結晶からの距離 *L* で表す。

3. 結果と考察

Ag を添加しない試料に比べて全体的に~20°C 低い温度 パターンで溶融凝固を行うことで、9種類のAg 添加試料 について、シングルドメインのバルクの育成に成功した。微細 組織観察の結果、L = 2 mmの位置ではAg が析出し、目立っ たボイドは見られなかった。一方、L = 5 mmの位置ではAgで 埋めきれなかったと考えられるボイドが見られた。種結晶から 離れた位置のボイドも埋めるためには、Ag₂O の最適添加量 は 10 wt%よりも多い可能性がある。

L = 3 mmの小片試料について、温度を変えて酸素アニー ルを 100 h 以上行い、その度に J_c -H 特性を評価した。酸素ア ニールは高い温度から順に 25°C 間隔で行った。その結果、 最高のピンカを示すために最適な酸素アニール温度は、Ag 添加試料では添加しなかった試料と比較すると~50°C 低くな った。また、Fig. 1 に示した(Gd,Dy)BCO のように、Ag 添加に より J_c が向上した試料も存在した。これは Ag の一部が Cu-O 鎖の Cu サイトに置換し、その領域が磁場中で有効なピンニン グセンターとして働いたためと考えられる[2]。

Fig. 2 に 9 種類の Ag 添加試料の L = 3 mm での 60 K に おける J_c の磁場依存性を示す。本研究で作製した試料の中 では、(Y,Er)BCO、(Dy,Y)BCO、(Gd,Dy)BCO が 3 T 以上の 磁場中で特に高い J_c を示した。例えば(Y,Er)BCO の J_c は 60 K, 3 T で~1.8 × 10⁵ A cm⁻² であった。これら高 J_c を達成した試 料は全て RE 混合バルク(RE' ≠ RE")であり、RE123 相の包晶 温度 T_p の大小関係が T_p (RE') = T_p (RE") + 10 ~ 20°C であっ た。 T_p (RE') > T_p (RE")であることが高 J_c に繋がった原因は最 終組織中の RE211 相粒子の粗大化が抑制されたためである と考えられる[3]。また、 T_p 間の差が 10 ~ 20°C よりも大きく なると、部分溶融状態の液相中の不均一な RE 分布が生じ やすくなることが考えられる。今後はこの指針を踏まえたうえ で、RE123 バルクのさらなる高 J_c 化を進め、捕捉磁場向上を 目指す。

参考文献

- 1. Y. Setoyama et al., Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 015014
- 2. T. Nakashima et al., J. Phys. Conf. Ser. 97 (2008) 012007.
- 3. Y. Setoyama *et al.*, *Abstracts of CSSJ Conference* **92** (2015) 41.



Fig. 1 *J_c-H* curves at 60 K for Ag-added and Ag-free (Gd,Dy)BCO melt-solidified bulks.



Fig. 2 *J_c-H* curves at 60 K for Ag-added (RE',RE'')BCO melt-solidified bulks.

バッファー層を用いた YBCO 超電導バルクの作製とその特性評価 Fabrication of YBCO superconducting bulk using buffer layer and evaluation of superconducting characteristics

<u>稲垣 絵梨子</u>,藤代 博之,内藤 智之(岩手大);Y-H. Shi, D A Cardwell (Cambridge 大) <u>INAGAKI Eriko</u>, FUJISHIRO Hiroyuki, NAITO Tomoyuki (Iwate Univ.); Y-H. Shi, D A Cardwell (Univ. of Cambridge) E-mail: t2215002@iwate-u.ac.jp

1. はじめに

これまで我々の研究室では、TSMG (Top Seed Melting Growth)法による REBa₂Cu₃O₂(REBCO,RE123)超電導バルク の作製と超電導特性の評価を行ってきた。より応用に向いた 超電導バルクの作製には、捕捉磁場や臨界電流密度などの 向上が不可欠となる。またバルクの結晶成長では、種結晶は バルクを劈開して作製するので品質が一定でないという点か ら、再現性の問題がある。最近では、種結晶とペレットの間に 挟むことで成長の助けとなるバッファー層を用いることにより REBCO 超電導バルクの再現性が向上することが報告されて いる[1]。そこで、本研究ではバッファー層を用いた YBCO 超 電導バルクを作製しその特性評価を行い、特性の向上や微 細組織への影響などバッファー層の有無が超電導特性にど のように影響するかを議論する。

2. 実験方法

YBCO 超電導バルクの原料粉には、原料粉 A(混合比 Y123:Y211=10:3+CeO₂0.5wt%)と原料粉 B(混合比 Y123:Y211=10:3.5+CeO20.5wt%)を20g用い、それぞれバッフ ァー層ありのバルクとバッファー層なしのバルクの合計4つを 作製した。Y123の仮焼き温度は、原料粉Aが880℃で、原料 紛Bは900℃であった。Y211の仮焼き温度は、どちらも880℃ であった。また、バルクの直径は25mmで厚さは9mmであっ た。バッファー層は直径5mmで、バルクと同様の原料紛0.15 gをそれぞれ用いた。セッティングは、種結晶の ab 面がバッフ ァー層の上になるようにした。温度パターンは、最初に 900 ℃ まで 100 ℃/h で昇温し、50 ℃/h で 1060 ℃まで昇温、1 h 保 持する。そして 50 ℃/h で成長開始温度 1005 ℃まで降温、 0.8℃/h で 995℃まで降温、さらに 0.4℃/h で成長終了温度 975 ℃まで降温し、100℃/h で室温まで降温した。バルク試料 はすべて、酸素中(20 cc/min)で 450 ℃で 3 日間、430℃で7 日間アニール処理をした。特性評価は、液体窒素温度(77 K) での捕捉磁場測定(印加磁場1 T)や捕捉磁場の温度依存性 の測定(印加磁場5T)、SQUID磁束計による臨界電流密度Jc の測定、走査型電子顕微鏡により 211 粒子の分散と大きさを 観察した。

3. 結果と考察

表1に作製した各試料名を示す。1回目の結晶成長では、 A1, B1を作製した。どちらも端まで結晶成長したが、B1にサ ブグレインが見られた。サブグレインがあると弱結合の問題に よりバルクの特性が下がることが分かっている。サブグレイン の原因は、B1ではY123の仮焼き温度が900℃であり、粉末 が硬く粒径が大きかったため、溶融に時間がかかったからで あると考えられる。よって2回目の結晶成長 A2, B2では、成 長開始温度の2段階目を995℃ではなく1000℃とし成長時間 が長くなるようにしたところ、どちらもサブグレインがなく端まで 成長した。

図1に各試料の捕捉磁場の温度依存性と挿入図に77K での捕捉磁場のプロットを示す。B2の捕捉磁場の温度依存 性は、減磁の段階で試料が割れてしまい測定が出来なかった。最も値が高かったのはA2であった。また、原料粉AとB で捕捉磁場に差があったのは、Y211の割合の違いによると考 えられる。Y211の割合が多いと結晶成長自体は成功しやすく なるが、捕捉磁場などの特性が下がることが分かっている。よ ってY211の割合が多い原料粉Bを用いたバルクの捕捉磁場 が低い結果となった。

今回の実験では、バッファー層の有無は捕捉磁場に大きく 影響はしなかった。また、Y211 の割合が少ないほうが、捕捉 磁場が向上した。Y123 の仮焼き温度が高いと粒径が大きくな り溶融に時間がかかってしまい、サブグレインの原因となる。 Y123 の仮焼き温度は880℃とし数回行った方がよい。講演当 日は、臨界電流密度や211粒子の分散と併せてバッファー層 の効果について議論する予定である。

Table.1 the trapped magnetic field at 77 K of each sample.

	Sample nam	ne trapped field at	magnetic 77K (T)
powderA bulk (with buffer	layer) A	1	0.540
powderA bulk (with no buf	fer layer) A	2	0.568
powderB bulk (with buffer	layer) B1	l	0.490
powderB bulk (with no buf	fer layer) B2	2	0.472



Fig.1 Temperature dependence of the trapped magnetic field and the trapped magnetic field at 77K of each sample.

謝辞

本研究はJSPSの2国間共同研究の一環としてケンブリッジ 大学のBulk Superconductivity Groupにご協力を頂いた。

参考文献

 Namburi Devendra Kumar, et al.: ACS Publications, Cryst. Growth Des. 2015, 15 p.1472-1480

Infiltration 法による MgB₂ バルクの作製条件の最適化 Optimization of fabrication condition for MgB₂ bulks prepared by infiltration method

<u>荻野</u>新,内藤 智之,藤代 博之(岩手大) <u>OGINO Arata,</u> NAITO Tomoyuki, FUJISHIRO Hiroyuki (Iwate Univ.) E-mail: t2215005@iwate-u.ac.jp

1. はじめに

MgB₂は金属間化合物中で最も高い超電導転移温度 T_=39 K を持つ。また、コヒーレンス長が長く、電磁的異方性 が低いという特徴を持つため、多結晶体で高い臨界電流密 度を得ることができる。高い捕捉磁場の MgB2 バルクを作製す るための方法として、高圧下焼結による充填率の向上が挙げ られるがコスト面で問題がある。そこで我々は、常圧下で高充 填率を得られる Infiltration 法[1]を用い MgB。バルクを作製し た。その結果、充填率 80-86%の MgB2 バルクにおいて、捕捉 磁場 2.4 T@15.9 K を実現した[2]。この値は高圧合成バルク に匹敵し、浸透法バルクとしては世界最高値である。しかし、 バルクにはクラックや不純物である Mg,B,5 が存在しており、そ れらを除去することでさらなる超電導特性の向上が期待できる。 また、過去の研究で Albisettii らが Mg2B25 は MgB2 生成時の 中間物であると報告している[3]。本研究では、様々な熱処理 条件で作製した試料断面の観察及び組成分析から Mg 融液 の浸透過程とMgB2生成という反応過程を明らかにし、最適熱 処理条件を確立することを目的とした。

2. 実験方法

原料粉末は結晶 B 粉末(純度 99%、粒径 45 μ m)、Mg 粉 末(純度 99.5%、粒径 180 μ m)を用いた。最初に片側を閉 じた SUS 管(外径 10 mm、内径 8 mm)に B 粉末を詰め、5 MPa で加圧した。次に Mg 粉末を詰め再度 5 MPa で加圧した後 に、アルゴン雰囲気中で密封し焼結した。Mg と B のモル 比は 1.1:2、B ペレットの高さは 15 mm とした。熱処理温 度は Mg の融点より高い 700、900℃、時間は 1、4、9 h と した。焼結後の試料は、表面観察のために縦断面を短冊 状に切り出した。X 線回折を用いて各試料の組成とピーク 強度を調べた。測定は短冊試料の底面を基準とし、2 mm 間隔で行った(Fig. 1 参照)。

3. 結果と考察

Fig.1 に各浸透実験で得られた短冊試料の写真を示す。 700℃-1 hと700℃-4 h 試料内部に空間が見られる。これは、 試料の切り出しの際の水の噴射によりMgB₂が生成していない 脆い部分が流されたためだと考えられる。また、700℃-9 hの 試料と900℃で焼結した全ての試料では空間が存在しないこ とから、Mg融液がSUS管の底まで浸透していると考えられる。

Fig.2 に各条件で作製した試料の中央における X 線回折の結果を示す。熱処理温度が 700℃の試料と 900℃の試料を 比べると、900℃試料の方が Mg₂B₂₅のピークが弱いことが分か る。Fig.3 に 700 ℃で熱処理した試料における MgB₂(101)面 の X 線のピーク強度の位置依存性のグラフを示す。なお、試 料内部に空間がある箇所の値は記載していない。グラフより 熱処理時間が長いほど、MgB₂ のピークが強くなっていること が分かる。

本研究では熱処理温度が高いほど Mg_2B_{25} のピークが弱く、 熱処理時間が長いほど MgB_2 のピークが強くなっていることか ら Mg_2B_{25} は MgB_2 生成の中間物であることが考えられ、 Albisettiiらの報告と一致した。







Fig.2 Normalized XRD patterns of MgB₂ samples fabricated by Infiltration method. ●MgB₂, ▲Mg, ■Mg₂B₂₅.



Fig.3 Position dependence of the peak intensity.

参考文献

- [1]G. Giunchi, Int. J. Mod. Phys. B 17 (2003) 453
- [2] 荻野、他:2015 年第 92 回秋季低温工学·超電導学会概 要集 92 (2015)1C-p06
- [3]A. Figini Albisettii et al : Solid State Sciences, Volume 14, Issue 11-12, p. 1632-1635.

チタン族元素を高ドープした MgB₂ バルクの捕捉磁場特性 Trapped field properties of MgB₂ bulks highly doped with titanium group elements

<u>髙橋 裕平</u>,内藤 智之,藤代 博之(岩手大) <u>TAKAHASHI Yuhei</u>, NAITO Tomoyuki, FUJISHIRO Hiroyuki (Iwate Univ.) E-mail: t2216018@iwate-u.ac.jp

1. はじめに

MgB₂超電導体は転移温度 T_c が 39 K と金属系超電導体 の中で最も高い。また RE-Ba-Cu-O 系 (RE:希土類元素) 超 電導体と比べてコヒーレンス長が長く電磁気的異方性が小さ いことから弱結合の問題がなく、多結晶体で高い臨界電流密 度 J_c が得られる。しかし、磁場中で J_c が大きく減少するため、 これまでの捕捉磁場の最高値は 5.4 T にとどまっている[1]。 MgB₂の磁東ピン止め特性の向上には、結晶粒微細化やチタ ン族元素[2,3]、C[4]などの不純物添加が有効である。我々も TiドープによってMgB₂バルクの捕捉磁場が大きく向上するし、 ドープ量 5-20%の広範囲で捕捉磁場がほとんど変化しないこ とを報告した[5]。また、Goto等は Zr および Hfドープの場合、 ドープ量 10%以上で更に J_c 特性が向上する可能性や不可逆 磁場が Tiドープの場合よりも高くなることを示した[3]。そこで、 本研究では MgB₂ バルクの捕捉磁場特性に対するチタン族 元素ドープ効果の詳細を明らかにすることを目的とした。

2. 実験方法

Mg、アモルファス B およびチタン族元素 (TGE: Ti, Zr, Hf) の粉末を $Mg_{1-x}B_2TGE_x$ (x = 0.01 - 0.5) となるように秤 量して混練したものを常圧焼結してチタン族元素がドープさ れた MgB₂粉末を得た。得られた粉末を 200-400 rpm で 1 h 遊星ボールミルによって微細化したものを出発原料粉末とし、 SPS 法を用いてバルク試料を作製した。SPS 焼結は 10-100 Pa の真空中において 950-1050℃で 5-15 min 行った。最大印加 電流は 1000 A、印加圧力は 50 MPa とした。試料の直径は約 20 mm で厚さは 7-11 mm であった。結晶構造は X 線回折 (XRD) 法により評価した。捕捉磁場は伝導冷却型超電導マ グネットを用いて 5 T の磁場を印加した後、試料を T_c 以下に 冷 却 し て 印 加 磁 場 を 取 り 除 く FCM (Field Cooled Magnetization) で捕捉させた磁場をバルク表面中心に設置 した極低温用ホール素子により測定した。

3. 結果と考察

Fig.1にTGEsを5%ドープしたバルク表面のXRDパター ンを示す。ZrとHfドープ試料ではTiドープ試料に比べて二 ホウ化物のピーク強度は大きく、MgB2のピーク強度は小さく なっている。Tiに比べてZrおよびHfとBの反応性が高い可 能性が考えられる。また、いずれのバルクでも出発原料粉末 よりSPS後のバルクの方がMgOやMgB4などの不純物が増 大した。MgB4はMgB2の分解によって生成し、MgOは余剰と なった Mg が炉内の残留酸素と反応して生成したと考えられ る。

Fig. 2 に Pristine バルクと TGEs を 5%ドープした MgB₂ バルクの捕捉磁場の温度依存性を示す。いずれの TGEs ドープバルクでも捕捉磁場がわずかに低下した。これは in-situ HIP 法で作製したバルクとは大きく異なる (Ti5%ドープバルクで 捕捉磁場は 1.3 倍向上) [5]。チタン族元素ドープによる J_c向上は(TGE)B₂ 生成による MgB₂ の粒成長抑制および緻密化 に起因する。従って、今回用いたバルク作製プロセスではこのメカニズムが有効に働かなかった可能性がある。その原因 については現在考察中である。

• MgB × MgB ♦ TiB MgO ■ ZrB₂ ▲ HfB Hf5% ntensity (a.u.) Zr5% Ti5% Pristine ××× 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2θ (deg.)

Fig. 1 XRD patterns of the pristine and titanium group elements (Ti, Zr, Hf) 5%-doped MgB_2 bulks fabricated by SPS method.



Fig. 2 Reduced temperature dependence of the trapped field for the pristine and titanium group elements (Ti, Zr, Hf) 5%-doped MgB₂ bulks fabricated by SPS method.

- 2. Y. Zhao et al., Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1154.
- 3. D. Goto et al., Physica C 392-396 (2003) 272.
- 4. S. X. Dou et al., Appl. Phys. Lett. 81 (2002) 3419.
- 5. T. Naito *et al.*, Supercond. Sci. Technol.**28** (2015) 095009

参考文献

1. Fuchs et al., Supercond. Sci. Technol., 26 (2014) 122002

HTS バルク磁石への複数回パルス着磁;去における残留磁場分布形状に対する 磁束侵入

Magnetic flux invasion in HTS bulk magnets with varying the shapes of remaining flux distributions in multiple-Pulsed Field Magnetization processes

<u>岡徹雄</u>,原健介,小川純,福井聡,佐藤孝雄(新潟大学);横山和哉(足利工大);村上明(一関高専) OKA Tetsuo, HARA Kensuke, OGAWA Jun, FUKUI Satoshi, SATO Takao (Niigata Univ.);YOKOYAMA Kazuya (Ashikaga IT); MURAKAMI Akira (Ichinoseki NCT)

E-mail: okat@eng.niigata-u.ac.jp

1. はじめに

その微細組織にピン止め点が導入された超伝導バルク磁 石(以後バルク磁石)は優れた磁場捕捉性能をもつ。簡便に このバルク磁石を磁化する方法にパルス着磁法があるが、そ の過程で、すでに磁化された試料のもつ磁場分布が、続いて 印加されるパルス磁場の侵入に強く影響することはすでに知 られている。本研究では、複数回着磁において磁場印加前に 捕捉されている様々な形状の磁場分布が、最終的な捕捉磁 場とその分布にどのように影響するかを実験的に調査した。 捕捉磁場の形状と続く磁場印加による発熱との関係を明らか にしてさらなる捕捉磁場性能の向上をねらう。

2. 実験方法

酸素中で合成して緻密に作成した Dy 123 系と、空気中で 作成し磁場捕捉性能の高い Gd123 系バルク磁石(共に ¢ 30mm×t10mm 新日本製鐵)が実験に用いられた。これを GM 冷凍機(AISIN 製 GD101S)で 30K まで冷却し、120mF のパ ルス電源から 114 ターンのパルスコイルを用いて、種々の磁 場捕捉形状になるよう磁場を印加した。次いで最終の7Tの磁 場を試料に印加して、磁場捕捉の振る舞いを評価した。パル ス印加中および印加後の磁場計測は結晶成長領域 GSR 上 でホール素子(F.W.Bell 製, BHT921T)によって行い、その位 置は中心からr=0, 3, 6, 9mm であった。印加磁場は順に5-7 T、5-5-7 Tである。7 T 印加の前にはどちらもM字型の磁 場分布を形成している。

3. 実験結果と討論

Fig. 2 に最後の 7Tの磁場印加前の磁場形状を示す。縦軸 が磁束密度 B_i(T)、横軸がバルク中心からの距離 r mm である。 Gd 系より J_c が低い Dy 系では、周辺が同等で中心が異なる捕 捉磁場を形成したが、この分布に7 Tを印加すると、中央部が 弱い M 字となる 5-5-7 T 印加の方が、Fig. 3 のように、中央部 での侵入磁場の増加速度が他に比べて大きいことがわかる。

一方の Gd 系では、周辺部の磁場分布を変化させたM字 分布(Fig. 3)に対して最後に7 Tを印加すると、単一パルスの 場合に比べて磁束侵入量が増加した。しかし Fig. 4 に示すよ うに、磁場侵入の増加速度に大きな差はなかった。これらの 結果から、M 字分布の形状に依存して、続く磁場印加での磁 束侵入挙動は変化し、これは J。に依存すると予想できる。

4. まとめ

予め磁場を捕捉させた J。の異なるDy系とGd系のバルク 磁石への磁場印加の際の磁束侵入の挙動を印加前の磁場 分布形状に関して実験的に調査した。試料周辺部が強く磁 化されたM字分布の場合にはDy系では中央部の強い磁場 捕捉が見られたが、Gd系ではその高い Jcのために中央で の磁場捕捉は制限された。その結果、続く7Tの磁場印加 に磁束侵入が促進され、試料中央部に 3.4Tの高い捕捉磁 場が得られた。



Fig.1 Pre-shaped distributions in Dy123 before 7-T application



Fig.2 Flux penetration speed in Dy123 at 7-T application after various pre-shaped distributions



Fig.3 Pre-shaped field distributions in Gd123 before 7–T application



Fig.4 Flux penetration behaviors in Gd123 during 7–T application

φ60 mm バルク体を用いた卓上型超伝導バルク磁石の特性評価 Estimation of basic characteristics of a desktop type superconducting bulk magnet using φ60 mm bulk sample

横山 和哉, クラワンシャ エランダ, 趙 元鼎, 香月 淳, 三浦 敦郎(足利工大);岡 徹雄(新潟大) YOKOYAMA Kazuya, ERANDA Kulawansha, ZHAO Yuanding, KATSUKI Atsushi, MIURA Atsuro (A.I.T.); OKA Tetsuo (Niigata Univ.) E-mail: k-yokoyama@ashitech.ac.jp

1. はじめに

小型強力磁石装置としての超伝導バルク磁石の産業応用 を目指して、スターリング冷凍機を用いた卓上型超伝導バル ク磁石装置を開発した。これまでは φ 45×15 mm の GdBCO バ ルク体を用いた冷却及びパルス着磁実験を行い、53 K の最低 到達温度と2.8 Tの捕捉磁場を確認した[1]。本文は総磁束量 の増大を目指して φ 60×20 mm の大型試料を取り付けるように 装置を改造し、基礎的な性能試験を行った結果を報告する。

2. 実験方法

φ60×20 mm の GdBCO バルク体(新日鉄住金製)をスター リング冷凍機(CryoTel CT, SUNPOWER, 冷却能力:8W@77K) のコールドヘッドに接続したサンプルステージに取り付ける。 真空チャンバを取り付けて真空断熱した後,最低到達温度ま で冷却した。この時,10 分毎にサンプルステージの温度を測 定した。着磁コイルを取り付けて3.1~6.2 T のパルス磁場(立 ち上がり時間:10 ms)を1回印加し,試料表面中央に取り付け たホールセンサにより,着磁中の磁束密度の時間変化を測定 した。その後コイルを取り外し,三次元ホールセンサを用いて 磁極表面(試料表面から4 mm)の磁束密度分布を測定した。

3. 結果及び考察

Fig. 1 にバルク体を室温から冷却した時のコールドステージにおける温度の時間変化を示す。 ϕ 45 mmの試料の場合,約4時間で51.3 Kの最低温度に到達したのに対して、 ϕ 60 mmの試料の場合,約6時間30分で最低到達温度は55.6 K であった。これは、体積が2.4 倍になっていることが影響していると考えられる。

Fig. 2 に総磁束量及び磁極表面における最大磁束密度, 試料表面の中央部における磁束密度と印加磁場の大きさの 関係を示す。折れ線グラフが磁束密度(左軸), 棒グラフが総 磁束量(右軸)の結果を, 丸シンボルが φ 60 mm の試料, 四 角シンボルがφ45 mmの試料の結果をそれぞれ示している。 ここで, 白抜きのシンボルで示した試料表面中央の磁束密度 は磁場印加後1分後の値となっている。4.6 T以上の印加磁 場で試料表面中央の磁束密度が大きく増加しており、φ45 mmの試料と比較して φ 60 mmの試料は 1.4~2.5 倍の値とな っている。また,総磁束量の結果において, 3.1 及び 3.9 T の 印加磁場では両試料の値に大きな差はないが、4.6 Tの場合 1.7倍に大きく増加している。これは試料が大型化したことによ る大きなメリットである。一方, 5.4 T以上の印加磁場において, 磁場印加後の発熱が大きくなり, 5.4 T では最大 90.4 K, 6.2 Tでは 92.9 K に達し, 捕捉磁場はほぼ 0 となった。これは, 試料の大型化による大きなデメリットである。さらに, 最高温度 に到達するまで30分以上経過しており、 φ45 mmの試料を用 いた場合や GM 冷凍機で φ 60 mm の試料を冷却した場合で

はこのような現象は見られず,スターリング冷凍機の冷却性能 でこの発熱を吸収することが難しいことを示している。今後, 更なる着磁方法の検討が必要である。

4. まとめ

本文はスターリング冷凍機を用いた卓上型バルク磁石にお いて、φ60 mmの大型試料を用いた場合の冷却及び単一パ ルス磁場を印加する基礎的な性能試験を行った。これまで用 いてきたφ45 mmの試料の場合と比較して最低到達温度に 大きな差はないが、冷却時間が1.6倍になってしまった。また、 印加磁場4.6Tで総磁束量が大きく増加したものの、5.4T以 上の印加磁場で臨界温度近くまでの温度上昇を観測した。 今後、最適な印加磁場の検討や、細孔バルク体を用いた発 熱の抑制などを検討し、大型試料における捕捉磁場の増大 を目指したい。



Fig. 2. Comparison of magnetic flux density at pole surface and bulk surface and total magnetic flux

参考文献

 K. Yokoyama, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 90 (2014) p.187

ソレノイド型とスプリット型コイルを用いた超電導バルクの パルス着磁とシミュレーション

Pulsed field magnetizing characteristics of rectangular-shaped GdBaCuO bulk using solenoid- and split-type coils

<u>高橋 圭太</u>,藤代 博之(岩手大);Mark Ainslie(Cambridge 大);内藤 智之(岩手大) <u>TAKAHASHI Keita</u>, FUJISHIRO Hiroyuki (Iwate Univ.); MARK Ainslie (Univ. of Cam);NAITO Tomoyuki (Iwate Univ.) E-mail: t2216017@iwate-u.ac.jp

1. はじめに

強力な磁場発生源としての RE-Ba-Cu-O 系超電導バルク 磁石の実用化のために、バルクの作製技術と同時にその着 磁技術が求められている。静磁場を印加して着磁を行う磁場 中冷却着磁 (FCM) に対し、パルス着磁 (PFM) では瞬間的 な磁束運動に伴う発熱により、捕捉磁場は FCM 法に及ばな い。当研究室では、ソレノイド型コイルを用いたマルチパルス 着磁は発熱の抑制に有効であるとして、2005年に直径45 mm の Gd 系バルクに対して PFM では最高となる5.20 T (30 K)を 達成した[1]。この他、バルクの上下に設置する新しい形のス プリット型及びボルテックス型コイルの利用により捕捉磁場の 向上が報告されているが[2]、両装置において同一のバルクを 用いた統一的な比較は行われていない。

本研究では、典型的な円盤形バルクに比べ隙間なく敷設 できるといった利点がある四角形 Gd 系バルクに対し捕捉磁 場向上のメカニズムを明らかにするため、ソレノイド及びヨーク を挿入したスプリット型コイルを用いて両装置におけるパルス 着磁特性の比較を実験的また解析的に行った。

2. 実験方法

試料は改良型 QMG 法[3]により作製された四角形バルク (33×33×15 mm³,新日鐵製)を使用した。Fig. 1 に着磁装 置の概略図を示す。捕捉磁場はバルク表面中心に設置した ホールセンサーにより測定し、磁場分布測定の際にはこれを 2 mm 上方で走査し測定した。温度は CERNOX 温度計により 各装置の治具側面で測定した。また、PFM 中の電磁場-熱伝 導シミュレーションには PHOTO-series (フォトン(株))を用い、 実験環境を再現するように 3 次元有限要素モデルを構築し解 析を行った。シミュレーションにおいて、ヨークは飽和磁化を 1.61 Tとし、典型的な純鉄系の電磁軟鉄を参考とした。

3. 結果と考察

Fig. 2(a) は両装置に対し各初期温度(T_s = 65 K, 40 K) における捕捉磁場の印加磁場依存性を示す。バルク表面中 心の最大捕捉磁場は、40 K においてスプリット型装置で 3.09 T であった。いずれの初期温度でも、スプリット型ではソレノイ ド型より高い捕捉磁場が得られた。この結果から、着磁コイル の違い及びヨークの存在がパルス着磁特性に影響していると 考えられる。

着磁シミュレーションの解析結果を述べる。Fig. 2(b) は両 装置に対し捕捉磁場の印加磁場依存性を示す。Fig. 2(a) と 同様にスプリット型装置の捕捉磁場はソレノイド型より高い値 を示した。熱伝導率の良好なバルクの ab 面からの冷却が可 能であるスプリット型では温度上昇の抑制が期待できる。とこ ろが、ヨークを用いない場合にはソレノイド型と同等の捕捉磁 場を示しており、温度上昇の抑制が捕捉磁場に与える影響は 小さいと言える。従って、ヨークの存在は捕捉磁場の向上に おける重要な要因である。

Fig. 3 は規格化したバルク表面における捕捉磁場分布の シミュレーション結果を示す。ヨークを用いたスプリット型の捕 捉磁場分布は、ヨークがない場合やソレノイド型と比較して、 Fig. 2に示すように磁場強度が向上するだけでなく、その均一性を増している。これはバルクに侵入した磁束が、磁化された ヨークに引き付けられることで *z*軸方向に安定して捕捉された ためであると考えられる。



Fig.1 Experimental setup of two kinds of apparatuses for PFM and the magnetizing coil, (a) solenoid type and (b) split type.



Fig.2 (a) Experimental and (b) analytical results of the trapped field B_z (r = 0) at the center of the bulk surface as a function of the applied field $B_{\rm ex}$ using the solenoid– and split–coil.



Fig.3 Normalized B_z profiles on the bulk surface for $B_{ex} = 5.00$ T using the solenoid- and split-coil.

参考文献

[1]H.Fujishiro *et al.* Physica C 445-448 (2006) 334
[2]T. Ida *et al.* Physica C 412-414 (2004) 638
[3]M. Morita *et al.* Physica C 235-240 (1994) 209-212

— 44 —

スプリットコイルを用いた MgB₂ バルクのパルス着磁による捕捉磁場 1.1 T の実現 Trapped field of 1.1 Tesla without flux jumps in an MgB₂ bulk during pulsed field magnetization using a split coil with a soft iron yoke

<u>藤代</u>博之,望月 豪彦(岩手大); Mark Ainslie(Cambridge 大); 内藤 智之(岩手大) <u>FUJISHIRO Hiroyuki</u>, MOCHIZUKI Hidehiko (Iwate Univ.); Mark Ainslie (Univ. of Cambridge); NAITO Tomoyuki (Iwate Univ.)

E-mail: fujishiro@iwate-u.ac.jp

1. はじめに

MgB₂バルクのパルス着磁(PFM)において flux jump が捕 提磁場を低減することは大きな問題であり、これまでの最大の 捕捉磁場は、ソレノイド型コイルを用いて $T_s=14$ K で $B_z=0.80$ T であった[1]。本研究では Flux jump の回避と捕捉磁場の増大 を目的に、スプリット型コイルを用いた PFM 着磁を行い、ソレ ノイド型コイルを用いた着磁と比較した。その結果、flux jump は高磁場まで発生せず、さらに軟磁鉄ヨークの挿入により捕 捉磁場が大きく向上し、 $T_s=13$ K で $B_z=1.1$ T を実現した。この 結果は MgB₂バルクの PFM による捕捉磁場の最高値である。

2. 実験·解析方法

HIP 法で作製した Ti-doped MgB₂ バルク(直径 22 mm,厚 さ 15 mm,磁場中冷却着磁(FCM)での B_z =2.23 T at 16 K)を 図1のように Cu 製ホルダーにマウントし、冷凍機を用いて 20 K 以下に冷却した。液体窒素冷却したスプリット型コイル(内 径 72 mm,外径 124 mm,厚さ 35 mm)のボアには一対の軟 磁鉄ヨーク(直径 60 mm,厚さ 65 mm,飽和磁化 1.6 T)を挿 入し、コンデンサバンクからパルス電流を流して最大 3 T の磁 場を印加した。バルク表面のホール素子により、捕捉磁場 B_z と磁場の時間変化 $B_z(t)$ 、及び Cu 製ホルダーに貼り付けた温 度計により温度の時間変化T(t)を測定した。また、有限要素 法により捕捉磁場と温度変化のシミュレーションを行った[2]。

3. 実験・解析結果

図2にスプリット型コイルを用いて $T_s=13$ K, 20 K での印加 磁場 B_{ex} と捕捉磁場 B_z の関係を示す。20 K では軟磁鉄ヨーク が無い場合とバルク底面に1つのヨークが存在するソレノイド 型コイルを用いた結果[1]も示す。ヨークが無いスプリット型コ イルとソレノイド型コイルでは、磁束がバルク中心に捕捉され 始める印加磁場は異なるが、最大捕捉磁場はほぼ等しい。し かし、ソレノイド型コイルでは高磁場印加($B_{ex}=2.2$ T)で flux jump が起こり、捕捉磁場が急激に減少するが、スプリット型コ イルでは 3 T までの印加磁場で flux jump は発生しなかった。ヨークを挿入したスプリット型コイルでは捕捉磁場が増大し、最大捕捉磁場は 20 K では 1.0 T, 13 K では 1.1 T となり、この 結果は MgB₂バルクの PFM による捕捉磁場の最高値である。

図3にバルク底面に1つのヨークが存在するソレノイド型コ イルとヨークを挿入したスプリット型コイルの代表的な印加磁 場 B_{ex}(t)とバルク表面の磁場 B_z(t)の時間依存性を示す。B_{ex}(t) とバルクへの磁束の侵入挙動 B_z(t)は2つのコイル系で異なり、 ヨークを挿入したスプリット型コイルでは B_{ex}(t)がゆっくりと立ち 下がり、B_z(t)の最大値は B_{ex}(t)とほぼ等しく、磁束のバルクへ の侵入挙動がかなり異なることが分かる。これらの実験的な振 る舞いは、有限要素法によるシミュレーションにおいても再現 されており、軟磁鉄ヨークを挿入したスプリット型コイルによる PFM 着磁は MgB₂、バルクの着磁に非常に有効である。

参考文献

- H. Fujishiro, T. Ujiie, H. Mochizuki, T. Yoshida and T. Naito, IEEE Trans. Appl. Supercond., 25, 6800104 (2015).
- H. Fujishiro, T. Naito and T. Yoshida, Supercond. Sci. Technol., 27, 065019 (2014).



Fig. 1. Experimental setup for split coil with two yokes



Fig. 2. Applied pulsed field, B_{ex} , dependence of the trapped field, B_z , at $T_s=20$ K using the split coil with two yokes, split coil without yoke and solenoid coil with one yoke. B_z , at $T_s=13$ K using the split coil with two yokes is also shown.



Fig. 3. Time dependence of local field, $B_z(t)$, at the center of the bulk surface and the applied field, $B_{ex}(t)$, (a) using the "solenoid coil with one yoke" at $T_s=20$ K and $B_{ex}=2.20$ T and (b) using the "split coil with tow yokes" at $T_s=13$ K and $B_{ex}=1.61$ T.

小型QMG®リングの捕捉磁場およびJ。の温度依存性

Temperature dependence of the trapped field and $J_{_{\rm C}}$ properties on a small $QMG^{^{\scriptscriptstyle B}}$ ring

<u>森田</u>充, 手嶋 英一, 成木 紳也(新日鐵住金) <u>MORITA Mitsuru</u>, TESHIMA Hidekazu, NARIKI Shinya(NSSMC) E-mail:morita.d98.mitsuru@jp.nssmc.com

1. はじめに

優れた特性を有するQMG®(単結晶状の123相中に211相が 微細分散したバルク状酸化物超電導材料)は、1988年に初め て開発された[1-4]。その後、希土類元素(RE)を置換した種 結晶を使用する単結晶育成技術により大型のQMG®が製造 可能となり種々の応用開発が進められた[5-6]。バルクマグネ ット応用は、1989年に提案されRE置換種結晶技術によりその 基本形が完成した[7-8]。最近では、特に低温・強磁場での着 磁により数Tの磁場が捕捉可能となり、各種のバルクマグネット 応用例が報告されている。

前回2015年度秋期の発表では、直径60mmの大型QMG®リングを用い10T着磁に成功したことを報告し、QMG®リングが 種々の10T級の強磁場応用に耐え得ることを示した[9]。今回、 QMG®の10T級応用設計の基礎データ取得のため、小型のQ MG®リングを用い12K、10Tで着磁した後、捕捉磁場の温度依 存性を測定することでJc(B)特性の温度依存性に関する評価 を試みたので報告する。

2. 実験方法

2-1 試料準備: Gd系Ag10wt%のQMG®から外径15mm,内 径7mm,厚さ5mmの小型リング試料を作製し,リングの中央 にホール素子を配置した。試料は下面を冷凍機のコールドへ ッドにグリースで固定した。

<u>2-2</u>着磁方法: 100Kで10Tの磁場を印加し12Kに冷却した後, 0.05T/分で所定の磁場まで減磁した。各外部磁場中で 0.5K/分で100Kまで昇温し,各外部磁場での試料中心位置の磁束密度の温度変化を記録した。

3. 実験結果·考察

各外部磁場中での試料中心の磁束密度の温度変化をFig. 1に示す。外部磁場ゼロの場合,小型ではあるものの約8.8Tの 磁束密度を捕捉している。また,試料中心の磁束密度から外 部磁束密度を差し引き,この捕捉磁場がゼロになる温度をT。と することで,T。(8T)が73Kに低下していることが分かる。

縦軸に捕捉磁束密度, 横軸に外部磁場を取り, フル着磁状 態になっていると思われる領域に関し, 各温度における捕捉 磁束密度の外部磁場依存性をプロットすることでピーク効果が みられた。さらに、リング試料内がフル着状態になっており, か つ, 均一な臨界電流密度の超電導電流が流れていると仮定し たときのJ_c(B)の温度依存性をFig.2に示す。60Kでは, 4T付近 に緩やかなピーク効果が見られ, 50K以下では10⁹オーダのJ_c が得られている。

このようなJ。評価法の特徴は、SQUID等の数mmの小片試料 の磁化による評価法に対して、外径15mmのリング試料を用い ていることから、比較的大きなループの超電導電流の平均値 であること、および外部磁場条件として自己磁界の影響が大 きいため、c軸相関ピンの影響が少なく、印加磁場の方位依存 性に関しても平均化されていることがあげられる。

これらの点から、今回の評価法は、QMG®バルクマグネットの設計において、より実践的な評価法であると思わる。今後、このような評価法によるデータが種々の機器設計に役立てば幸いである。



Fig. 1 Temperature dependence of the field at the center of the QMG^{\circledast} ring in each external field



Fig. 2 Field dependence of the J_c at each temperature

参考文献

- 1. 森田充,松田昭一: New Superconducting Materials Forum News, No*10* (1988) 15
- M. Morita, et al.: Patent No. US-5508253, Priority date:06.06.1988.
- 3. M. Morita, et al.: Physica C 172(1990)383-387 [参考文献 1.の英訳]
- 4. 森田 充:博士論文「溶融成長法による大型酸化物超伝 導体の作製と高臨界電流密度化に関する研究」 北海道大学学術成果コレクション(HUSACP) http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/statistics/statslist.php?st aturl=fma3serq5o2379t
- 5. 森田 充等:特許登録番号:2556401
- M. Morita et al.: Advances in Superconductivity III (1991)733
- 7. 森田 充: 特許登録番号:2055511
- M. Morita, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 41 (1989) p.14
- M. Morita, et al.: Abstracts of CSSJ Conference, Vol. 91 (2015) p.210

— 46 —